

請求の範囲

- [請求項1] ガラス基板と透明導電膜とを有する、エレクトロクロミック調光素子用の積層基板であって、
- 前記ガラス基板は、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化ホウ素、アルカリ土類金属酸化物およびアルカリ金属酸化物を合計で90mol%以上含有し、かつアルカリ金属酸化物を合計で12mol%以下含有し、
- 前記透明導電膜は、前記ガラス基板側から、スズを含有する酸化インジウム膜と、タンタル、アンチモンおよびフッ素のうち1つ以上を含有する酸化スズ膜とをこの順で有し、
- 前記酸化インジウム膜は前記ガラス基板に直接に形成されており、前記酸化インジウム膜の波長1.3 μm における屈折率が0.4よりも小さく、かつ前記酸化インジウム膜の波長1.3 μm における消衰係数が0.4よりも大きく、
- 前記酸化スズ膜の膜厚が35 nmよりも大きい、エレクトロクロミック調光素子用の積層基板。
- [請求項2] 前記酸化スズ膜の膜厚が150 nm以下である、請求項1に記載のエレクトロクロミック調光素子用の積層基板。
- [請求項3] 第1ガラス基板と、第1透明導電膜と、酸化発色層と、電解質層と、還元発色層と、第2透明導電膜と、第2ガラス基板とをこの順で有する、エレクトロクロミック調光素子の製造方法であって、
- 前記第1ガラス基板と前記第1透明導電膜とで構成される第1積層基板、および前記第2ガラス基板と前記第2透明導電膜とで構成される第2積層基板のうち、少なくとも一方の積層基板を350℃以上に加熱する工程を有し、
- 前記第1積層基板および前記第2積層基板のうち350℃以上に加熱される積層基板として、請求項1または2に記載の積層基板を用いる、エレクトロクロミック調光素子の製造方法。